

## 高真空蒸着装置 ED-1600



高真空蒸着装置ED-1600は抵抗加熱と電子銃を標準装備しております。金属、貴金属、酸化物の成膜も容易にできます。排気系の立ち上げ、立ち下げ、蒸着準備、ベントを自動で行い、成膜制御も水晶式膜厚計により自動で行います。加熱機構はハロゲンランプ2基を標準装備しておりますので、基板加熱も300℃まで短時間で昇温可能です。研究用として開発された本装置は中規模の生産用としても十分満足できる仕様で、各方面の研究機構、メーカー様に納入させて頂いております。蒸着装置は金額が高価だという多くのご要望を、弊社は原価の見直しを行った結果、中規模生産用装置として破格の1000万円台を実現しました。仕様も多種多様。貴社・貴学のご要望に合わせて設計・製作可能ですので是非御相談ください。

### 高真空蒸着装置 ED-1600 仕様

- 到達圧力 5.0×10<sup>-4</sup>Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ600mm×650mmH水冷パイプ巻 SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃最大投入電力:5kW  
ルツボ容量:2.9mL  
ルツボ個数:4個  
抵抗加熱最大電力:AC5V400A  
抵抗電極数:1対(ポート)
- 基板形状 □50mm □100mm いずれも対応
- 基板回転 ドーム形状:φ550mm×100mmH×2mm(材質:Al)  
モーター直接駆動方式 0~30rpm
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.5kW×2式  
常温~300℃迄昇温可能  
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:667/800L/min[50Hz/60Hz]  
ターボ分子ポンプ:500L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 制御系 ターボ分子ポンプコントローラ
- 操作方法 手動/自動(排気系立ち上げ/蒸着準備/ベント/排気系立ち下げ:4種類)
- ユーティリティ電気:AC200V三相20kVA  
冷却水:20L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環  
計装エア:0.5MPa以上  
寸法 装置架台本体:955mmW×770mmD×(1810)mmH  
制御盤:590mmW×800mmD×(1825)mmH